

Doc. No.: NR060705

2006年7月5日

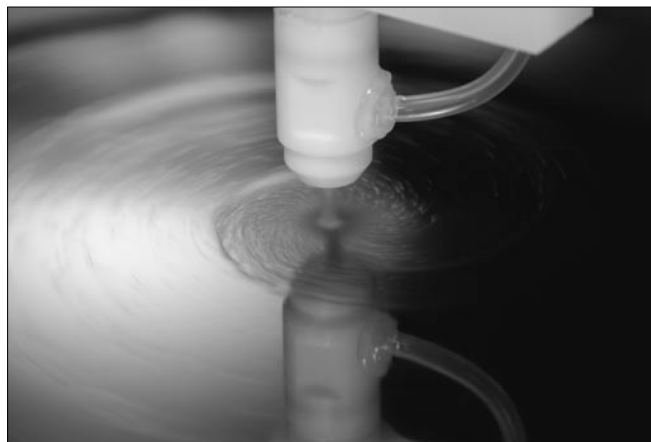
## 半導体の次世代を担うウエハー洗浄技術の独自開発に成功 ～超微細粒子による物理洗浄により、処理対象デバイスを拡大～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武 隆成)はこのほど、45ナノメートル世代の超微細パターンのウエハー洗浄を可能にする新技術「Nanospray2(ナノスプレー2)」の独自開発に成功しました。

回路の超微細化が進む半導体業界では、線幅65ナノメートル(ナノは十億分の一)だけでなく、45ナノメートル以降の次世代デバイスに対応するプロセス技術の確立が急務となっています。そのためウエハーの洗浄プロセスにおいては、微細化に加え、材料の多様化にも対応できる柔軟さを持った洗浄技術が求められています。

「Nanospray2」は、ウエハー枚葉洗浄装置に搭載する、45ナノメートルプロセスに不可欠となる新たな洗浄技術で、2003年のリリース以来高い評価とシェアを獲得してきた65ナノメートル対応の洗浄技術「Nanospray(ナノスプレー)」をさらに進化させたものです。液体の超微粒子を、ウエハー表面に最適な条件で噴射することにより、従来は困難とされていた超微細パターンのデバイス洗浄において、極限までダメージを抑えることに成功。次世代半導体デバイスの歩留まり向上に、大きく貢献する技術となっています。また、さまざまな種類の洗浄方法に対応できるため、各デバイスメーカーの多彩な製造プロセスに柔軟に導入できます。さらに、使用する窒素など気体の消費量を、従来の約半分に抑えることが可能で、ランニングコストの大幅な削減を実現するとともに、環境保護にも配慮した技術となっています。

当社では、すでに実装置に「Nanospray2」を搭載した状態での実用的な検証を終え、デバイスメーカーからも高い評価を得ており、今後あらゆる枚葉洗浄装置に順次搭載していく予定です。当社は、今回開発した「Nanospray2」により、業界をリードするウエハー洗浄装置の競争力を一層強化し、さらなるシェアの拡大を目指します。



Nanospray2

☆ この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。  
([www.screen.co.jp/press/nr-photo/](http://www.screen.co.jp/press/nr-photo/))

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目